

粒子束及加速器技术

光刻及离子束蚀刻技术制作DNA芯片模版

[张新宇¹](#) [汤庆乐²](#) [张智³](#) [易新建³](#) [裴先登¹](#)

(1. 华中科技大学 计算机学院外存储系统国家专业实验室, 湖北 武汉 430074; 2. 中国船舶重工集团 华中光电技术研究所, 湖北 武汉 430074; 3. 华中科技大学 光电子工程系, 湖北 武汉 430074)

摘要: 采用光刻及离子束蚀刻技术制作面阵石英DNA芯片模版, 利用扫描电子显微镜 (SEM) 和表面轮廓仪测试了所制石英DNA芯片模版的表面微结构形貌特征, 分析了所制石英DNA芯片模版出现图形畸变的原因。所用工艺为在其它衬底材料表面制作更大规模及具有复杂结构的大面阵DNA芯片模版奠定了基础。

关键词: [芯片模版](#) [离子束蚀刻](#) [光刻](#)

通信作者: